



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203046352 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201220677578. 7

(22) 申请日 2012. 12. 11

(73) 专利权人 常州依丽雅斯纺织品有限公司

地址 213125 江苏省常州市新北区汉江西路
118 号

(72) 发明人 沈莉萍

(74) 专利代理机构 常州市科谊专利代理事务所
32225

代理人 孙彬

(51) Int. Cl.

B32B 15/02 (2006. 01)

B32B 27/12 (2006. 01)

B32B 27/20 (2006. 01)

B32B 33/00 (2006. 01)

A47H 23/08 (2006. 01)

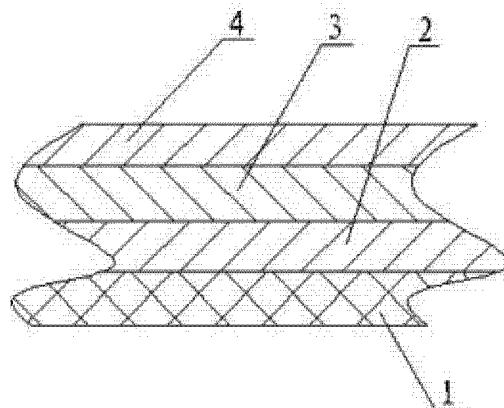
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

高效反光窗饰材料

(57) 摘要

本实用新型公开了一种高效反光窗饰材料，它包括基布，基布上由内向外依次涂覆有粘结层、遮光层和反光层，所述的遮光层由分布有炭黑和滑石粉的含硅有机酸类高分子材料制成，所述的反光层由分散有铝银粉材料的水性浆料制成。本实用新型提高了基材的遮光效果，对光线反射效果可达 90% 以上，可有效降低外部环境光污染，同时对室内温度具有一定的保温效果。



1. 一种高效反光窗饰材料,它包括基布(1),其特征在于:基布(1)上由内向外依次涂覆有粘结层(2)、遮光层(3)和反光层(4)。

2. 根据权利要求1所述的高效反光窗饰材料,其特征在于:所述的基布(1)为染色面料或印花面料。

3. 根据权利要求1所述的高效反光窗饰材料,其特征在于:所述的基布(1)由聚酯网络丝织造而成。

高效反光窗饰材料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种高效反光窗饰材料,属于家纺用品技术领域。

背景技术

[0002] 目前,随着城市建设的不断扩张,高楼大厦采用幕墙玻璃作为装饰的主要手段,光辐射、光污染严重影响城市百姓的生活,为此开发出具有高效遮光同时能够有效反射光线热量的银离子遮光窗帘,可有效改善人居环境。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种高效反光窗饰材料,它不仅具有遮光效果、还能有效降低外部环境光污染、同时对室内温度具有一定的保温效果。

[0004] 实现本实用新型目的的技术方案是:一种高效反光窗饰材料,它包括基布,基布上由内向外依次涂覆有粘结层、遮光层和反光层,所述的遮光层由分布有炭黑和滑石粉的含硅有机酸类高分子材料制成,所述的反光层由分散有铝银粉材料的水性浆料制成。

[0005] 进一步,所述的基布为染色面料或印花面料。

[0006] 更进一步,所述的基布由聚酯网络丝织造而成。

[0007] 采用了上述技术方案后,本实用新型提高了基布的遮光效果,对光线反射效果可达 90% 以上,可有效降低外部环境光污染,同时对室内温度具有一定的保温效果。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的高效反光窗饰材料的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,

[0010] 如图 1 所示,一种高效反光窗饰材料,它包括基布 1,基布 1 上由内向外依次涂覆有粘结层 2、遮光层 3 和反光层 4,遮光层 3 由分布有炭黑和滑石粉的含硅有机酸类高分子材料制成,反光层 4 由分散有铝银粉材料的水性浆料制成。

[0011] 基布 1 为染色面料或印花面料。基布 1 由聚酯网络丝织造而成。

[0012] 本实用新型的制作过程如下:

[0013] 1、通过热定型整理,获得优异外观和稳定尺寸的基布 1。

[0014] 2、利用经均匀分散 1200 目的滑石粉交联到基布 1 表面,形成粘结层 2,有效对基布 1 组织点进行封孔,经轧光整理,赋予基布致密的组织,有效提高封孔率。

[0015] 3、将具有优异遮盖力的纳米级的炭黑和 800 目的滑石粉均匀分布在含硅有机酸类高分子中,通过直涂工艺,制成 0.3-0.4mm 的遮光层 3,赋予面料优异的遮光率。

[0016] 4、将粒径在 10—30 μm 的铝银粉材料均匀分散在水性浆料中,经直涂工艺整理均

匀覆盖在遮光层 3 上,形成反光层 4,赋予产品优异的遮光和反射效果。

[0017] 本实用新型提高了基布 1 的遮光效果,对光线反射效果可达 90% 以上,可有效降低外部环境光污染,同时对室内温度具有一定的保温效果。

[0018] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

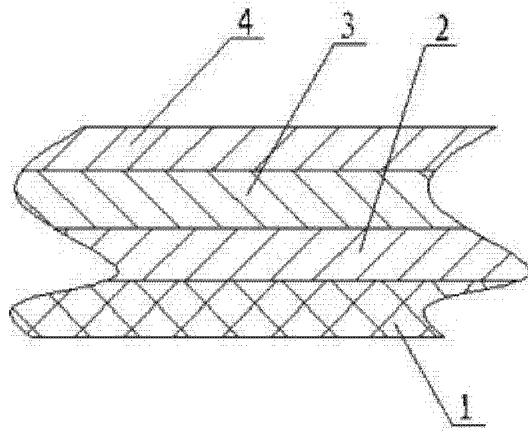


图 1